

サムコ株式会社 会社説明会

「当社事業の現状と今後の展開について」

薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。

2025年10月21日（火）

サムコ株式会社
証券コード: 6387

自己紹介



かわべ つかさ
川邊 史
代表取締役社長 兼 COO

生年月日：1974年12月7日 三重県津市出身

略歴

1999年4月 中部電力株式会社 入社

2008年7月 サムコ株式会社 入社

2012年10月 取締役執行役員 オプトフィルムス研究所部長

2014年11月 取締役常務執行役員 海外事業推進兼新規事業担当

2016年10月 取締役常務執行役員 海外事業統括

2017年10月 取締役専務執行役員 海外事業統括

2018年10月 代表取締役社長 兼 COO（現任）

趣味

新しいことにチャレンジする

本日のアジェンダ

- 1 会社紹介
- 2 第47期 業績のご報告
- 3 今後の成長戦略
- 4 質疑応答

01

会社紹介

薄膜技術で世界の産業科学に貢献する

Mission

経営理念

- 企業の永続的な発展を追求し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者とともに**成長する**企業を目指して、**薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。**

経営方針

1. 社員の**創造**性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。
2. **直販体制**を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。
3. 事業が社会に果たす役割を積極的に認識し、**高い付加価値**を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

グローバル中堅企業

Vision

1. **独立性**と自由な**グローバル展開**を貫き、独自技術で収益機会を最大化。
2. コア技術（**薄膜技術**）で高参入障壁を築き、**価格決定力**による**高収益率**を維持。
3. 利益効率を最優先し、投下資本を最大活用することで、**高収益事業**に経営資源を集中投下。
4. **少数精鋭のプロ集団**による機動的で**スピード重視**の経営で、高生産性とROE向上を実現。
5. 健全な経営と社会貢献を通じて、**国家・地域の発展**に寄与し、中長期的な企業価値を創出。

製品ラインナップ



deposition



etching



surface
treatment

■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置

■ドライエッチング装置

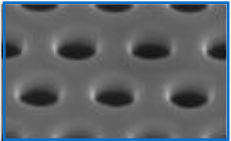
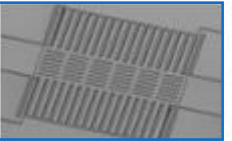
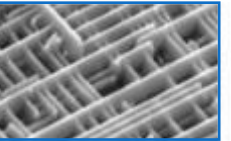
- ALE (Atomic Layer Etching) 装置
- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- XeF₂ドライエッチング装置

■ドライ洗浄装置

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー

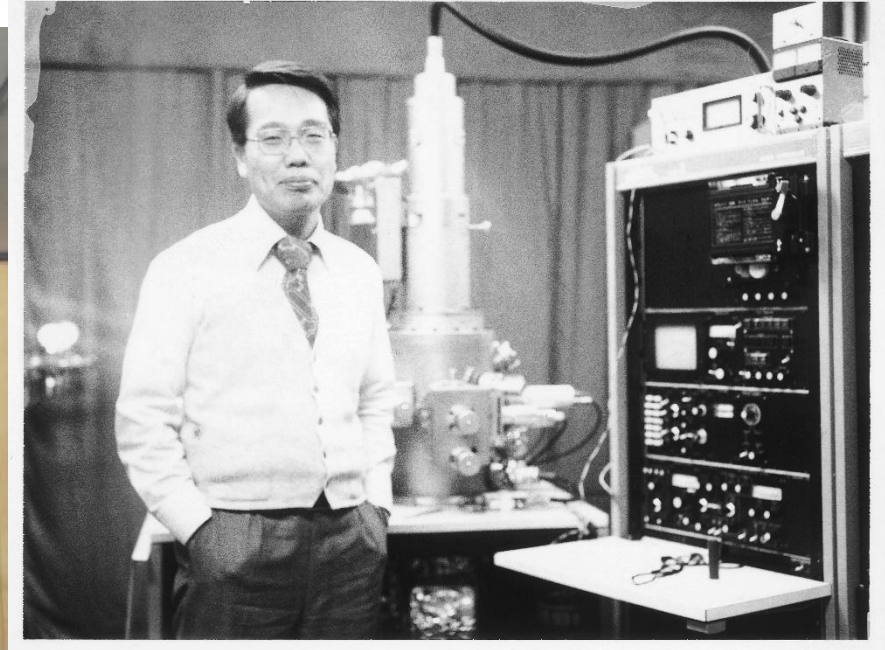


事業概要 ～非シリコン分野のリーディングカンパニー～

									
LED	Laser, VCSEL	Photonic Crystal	Power Device	RF Device	RF Filter	Capacitor	MEMS, TSV	Failure Analysis	R&D
CVD装置: ALD, PECVD, LSCVD®, DLC Coating									
ドライエッチング装置: ALE, ICP, DRIE, RIE, XeF ₂									
ドライ洗浄装置: Aqua Plasma®, Plasma Cleaning, UV Ozone Cleaning									

当社は、**世界中の**大学・研究機関と半導体製造工場へ
プラズマCVD、ドライエッチング、ドライ洗浄**装置を提供**しています。

1979年創業のガレージカンパニー



1980

半導体プロセス用大型CVD装置の開発、販売を開始

1981

化合物半導体製造用MOCVD装置の開発、販売を開始

国産初

1979

サムコインターナショナル研究所 設立



1984

東京都品川区に東京出張所（現東日本営業部）を開設

1987

米国カリフォルニア州にオプトフィルムス研究所を開設

沿革

液体ソースによる高速成膜用CVD装置の開発、販売を開始

1990

1995

小型、汎用プラズマエッチング装置RIE-10NR
の開発、販売を開始

700 台
以上の実績



1997

キリンビール株式会社と共同で、
プラスチックボトルにDLC膜を形成する技術を開発

2001

日本証券業協会に株式を店頭上場

2004

株式会社サムコインターナショナル研究所から
サムコ 株式会社へ社名を変更

2015

原子層堆積（ALD）装置AL-1の開発・販売を開始

2016

Aqua Plasma®洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始

2021

クラスターツールシステム「クラスターH™」の販売を開始

2013

東京証券取引所市場第二部へ上場市場を変更

2014

東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2022

プライム市場へ移行

2025

先端技術研究棟を竣工

先端
技術研究棟
竣工



先端技術研究棟を竣工 2025年9月



サムコの次世代研究開発の 中核拠点

- 中期経営計画において重点課題と位置付けるクラスターツールシステムの拡販のための研究開発機能をさらに充実させるため建設。
- 180 m²のクリーンルームはクラス1,000（米国連邦規格）の清浄度で、ポンプ類はバックヤードに設置し、パーティクルの発生を抑え、生産工場と同じ環境で開発

日本国内拠点

京都



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



先端技術開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟



▶ 事業拠点 | サムコ株式会社 (samco.co.jp)

本社周辺のアクセスマップやGoogle mapのご案内はこちら

海外営業・サービス拠点（11拠点）



▶ 事業拠点 | サムコ株式会社 (samco.co.jp)

海外拠点の住所やGoogle mapのご案内はこちら

取締役紹介 2024年10月～



辻 理
代表取締役会長 兼 CEO



川邊 史
代表取締役社長 兼 COO



山下 晴彦
取締役専務執行役員
生産統括部長 兼 製造部長



宮本 省三
取締役執行役員
管理統括部長 兼 経理部長



佐藤 清志
取締役執行役員
営業統括部長



村上 正紀
社外取締役



高須 秀視
社外取締役



藤田 静雄
社外取締役



柳本 依子
社外取締役

(2025年10月21日時点)

02

第46期 業績のご報告

25/7月期 業績ハイライト

売上高

93.4 億円

前年同期比 +13.9%

4期連続増収・過去最高



営業利益

23.4 億円

前年同期比 +16.1%

5期連続増益・過去最高



経常利益

23.7 億円

前年同期比 +13.6%

6期連続増益・過去最高

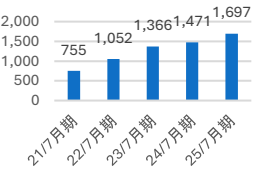


当期純利益

16.9 億円

前年同期比 +15.3%

6期連続増益・過去最高

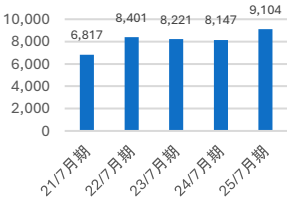


受注高

91.0 億円

前年同期比 +11.8%

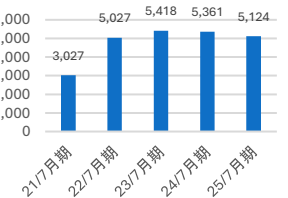
過去最高



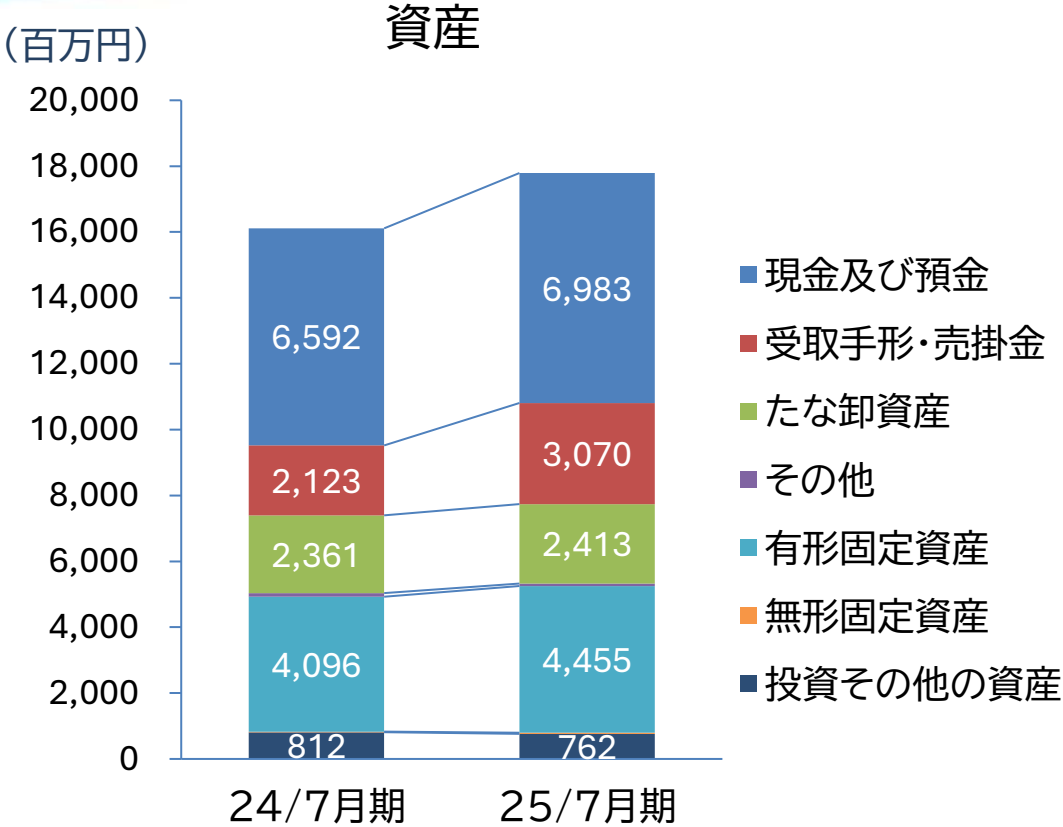
受注残高

51.2 億円

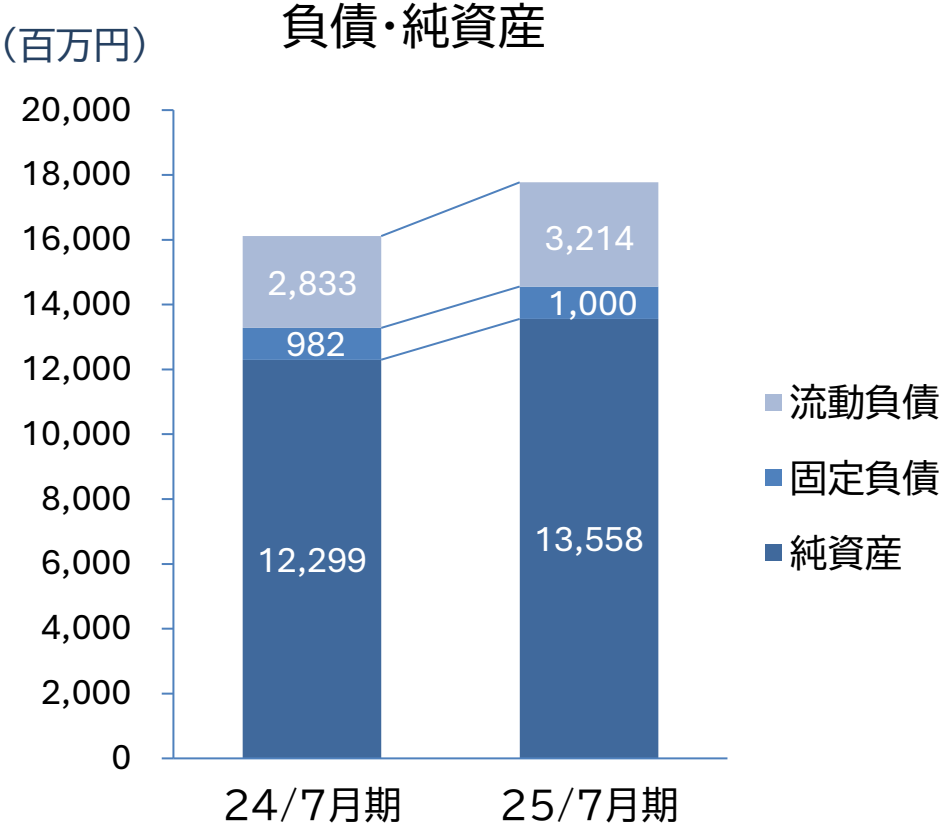
前年同期比 △4.4%



25/7月期 貸借対照表（前事業年度末比）

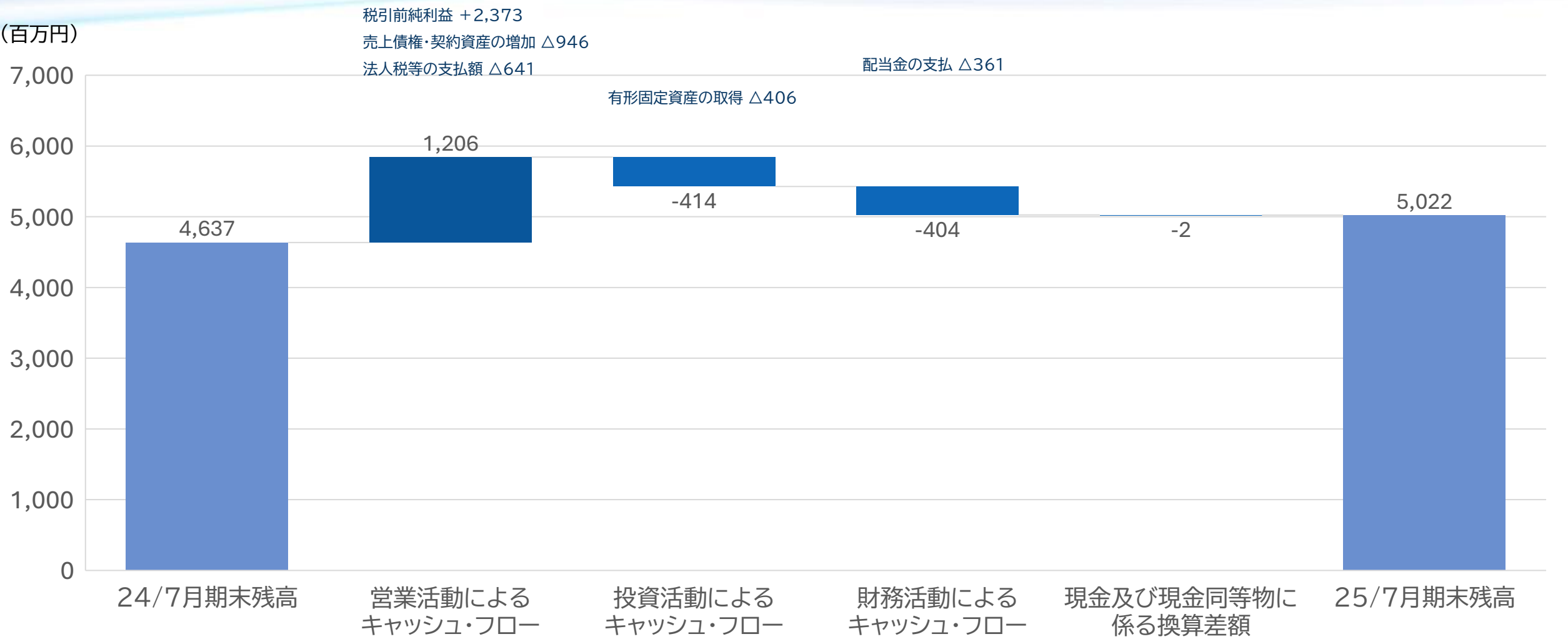


- ・ 現金及び預金 391百万円増
- ・ 受取手形・売掛金 947百万円増
- ・ たな卸資産 52百万円増
- ・ 建設仮勘定 362百万円増



- ・ 買掛金 115百万円増
- ・ 長期借入金 39百万円減
- ・ 繰越利益剰余金 1,335百万円増

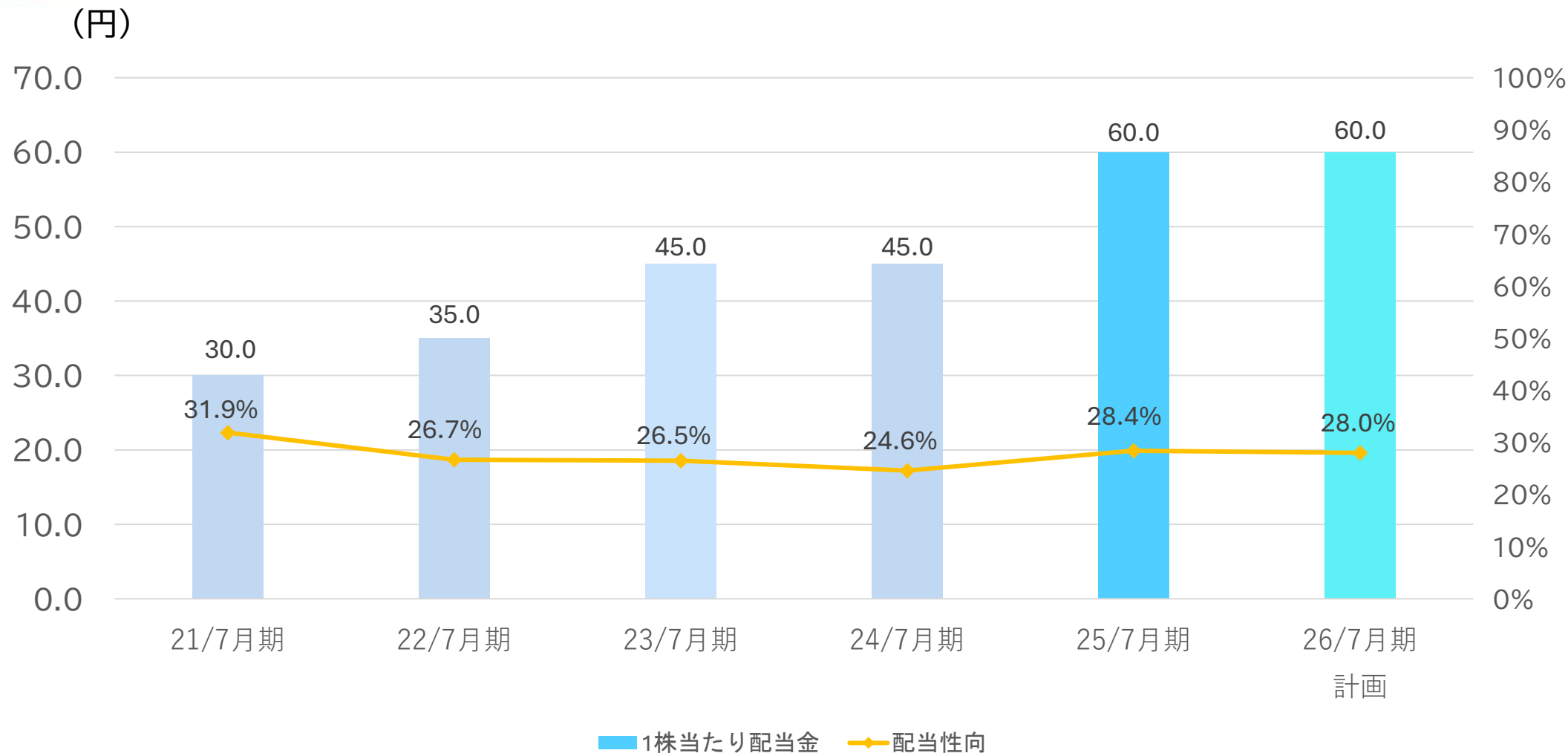
25/7月期 キャッシュ・フロー



26/7月期 業績予想

(百万円)					
	25/7月期	26/7月期			前年同期比
		上期予想	下期予想	通期予想	
売上高	9,342	4,750	5,450	10,200	9.2%
売上総利益	4,668	2,310	2,680	4,990	7.0%
売上高総利益率	50.0%	48.6%	49.2%	49.0%	-
営業利益	2,342	1,070	1,390	2,460	5.0%
営業利益率	25.1%	22.5%	25.5%	24.2%	-
経常利益	2,373	1,060	1,380	2,440	2.8%
当期純利益	1,697	740	980	1,720	1.4%

配当性向と1株当たり配当金の推移



03

今後の成長戦略

サムコを取り巻く環境

自動車の電装化と自動運転進展

- パワーエレクトロニクス
- 高精度センサー
- ECU（電子制御ユニット）



AIとデータセンターの爆発的成長



IoTの普及

- センサー
- 通信モジュール



5G/6Gと通信インフラの高度化

- 高周波部品
- 高密度実装



量子コンピューターの社会実装



ヘルスケアの拡大

- 遠隔医療
- リモートモニタリング



Source: Precedence RESEARCH

サムコを取り巻く環境 AIと量子の発展とともに

世の中の動き

生成AI

普及により
データセンターの
需要爆発

量子

デバイスによる
新演算・センシング技術で
新たなイノベーション



光電融合

低消費電力・高速通信技術
NTTのIOWN構想により
オプトデバイスの需要増加

超伝導, Si, 光

各種方式で研究開発が加速
理化学研究所、産業技術研究所、
東京大学、NTTなど基盤開発

技術開発

中期経営計画 重要指標



	第46期（実績）		第49期
売上高 （前年比）	93.4億円	+32%	123億円
装置製造原価率	46.6%		46.0%
営業利益 （営業利益率）	23.4億円 （25.0%）	+34%	31.4億円 （25.6%）
海外売上高 （海外売上比率）	35.8億円 （38.4%）	+72%	61.5億円 （50.0%）
国内売上高	57.5億円	+7%	61.5億円

中期経営計画 重点施策

重点施策		実施項目
1	新しいプロセス及び新規装置の開発、販売	- 先端化合物半導体用途装置開発 - 電子部品用途装置開発
2	生産機販売の強化	- 専属販売チーム立上げ - 部品、メンテナンス専属部署設立
3	海外販売の拡大	- 北米、中国、台湾、韓国、東南アジアに続くマーケット開拓 - 海外売上比率50%以上
4	生産体制の拡充	- 工場の生産能力向上 - 生産平準化
5	更なる成長に向けた人員育成・活躍推進	- 社員教育 - 高度人材の採用
6	サステナビリティへの取り組み	- 装置のCO₂排出量抑制 - 社会貢献

中期経営計画 重点施策1 新プロセス・新規装置の開発・販売

ALE（原子層エッチング）装置



GaN系パワーデバイス向け
低ダメージ、深さ高精度制御加工

ハード開発およびプロセス開発

ALD（原子層成膜）装置



電子デバイス向け
酸化膜、窒化膜、および導電性膜の成膜

新プラズマ源の開発

クライオICPエッチング装置



-100°C以下を実現する極低温装置
ガスや部材評価用

新規用途発掘

Aqua Plasma® クリーニング装置

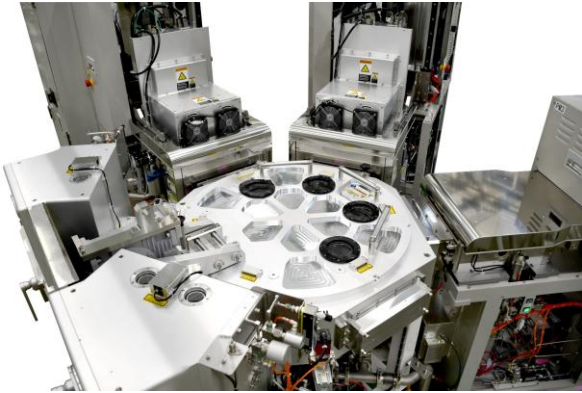


サムコ独自の水蒸気プラズマ
大面積基板の還元および洗浄に

ウェハーやパネルレベル装置への対応

中期経営計画 重点施策2 生産機販売の強化

生産機ラインナップを拡充



電子デバイス製造向け
クラスターツールシステム「クラスターH™」



顧客ニーズに合わせた体制を構築

専属販売チームの立上げ

生産向けの顧客ニーズに精通した担当者を配置し、
密な連携を強化

部品・メンテナンス専属部署

業務効率化と売上増大を目指し、アフターサービス
体制を強化



生産用ALD装置を市場投入

中期経営計画 重点施策3 海外販売の拡大

1. 既存拠点（北米、中国、台湾、韓国、東南アジア）の強化
2. 欧州・インドなど新市場の開拓

欧州

- 東スイス応用科学大学との連携強化
- 学会へ参加し知名度向上

リヒテンシュタイン・
Samco-ucp Ltd.

北京事務所

上海事務所

韓国事務所

台湾・新竹事務所および

台南サービスオフィス

インド・

ベンガルサービス

シンガポール支店

マレーシア事務所

東南アジア・韓国

- SEMICON SEA出展
- SEMICON Korea出展を検討

ニュージャージー州

イーストコーストオフィス

カリフォルニア州（シリコンバレー）
オプトフィルム研究所

米国

- 東海岸のサービス人員を強化
- MITなどの研究所でセミナーを開催

中期経営計画 重点施策4 生産体制の拡充

工場の生産能力向上

- 工場の各エリアの占有面積と利用目的を明確にし、デッドスペース（未使用スペース）がないか、通路や保管場所が適切かを評価し、製造スペースを増床

設備・人材両面の強化による
高効率生産体制へ

生産平準化

- 顧客管理システムから抽出した需要予測を元に見込み生産の精度を向上



中期経営計画 重点施策5 更なる成長に向けた人材育成・活躍推進

社員教育

1. サムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」にて当社社員2名が博士号を取得。



高度人材の採用

1. インドITや韓国の大学の学生の会社見学を受け入れ



中期経営計画 重点施策6 サステナビリティへの取り組み

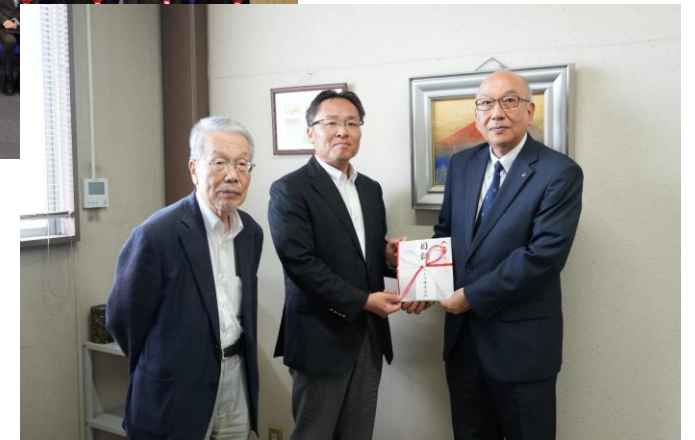
装置のCO₂排出量抑制

- 装置のスループット向上×フットプリント削減



社会貢献

1. サムコ科学技術振興財団による若手研究者支援
2. 日本赤十字への寄付
3. 京都大学レクチャーシップアワードへの寄附

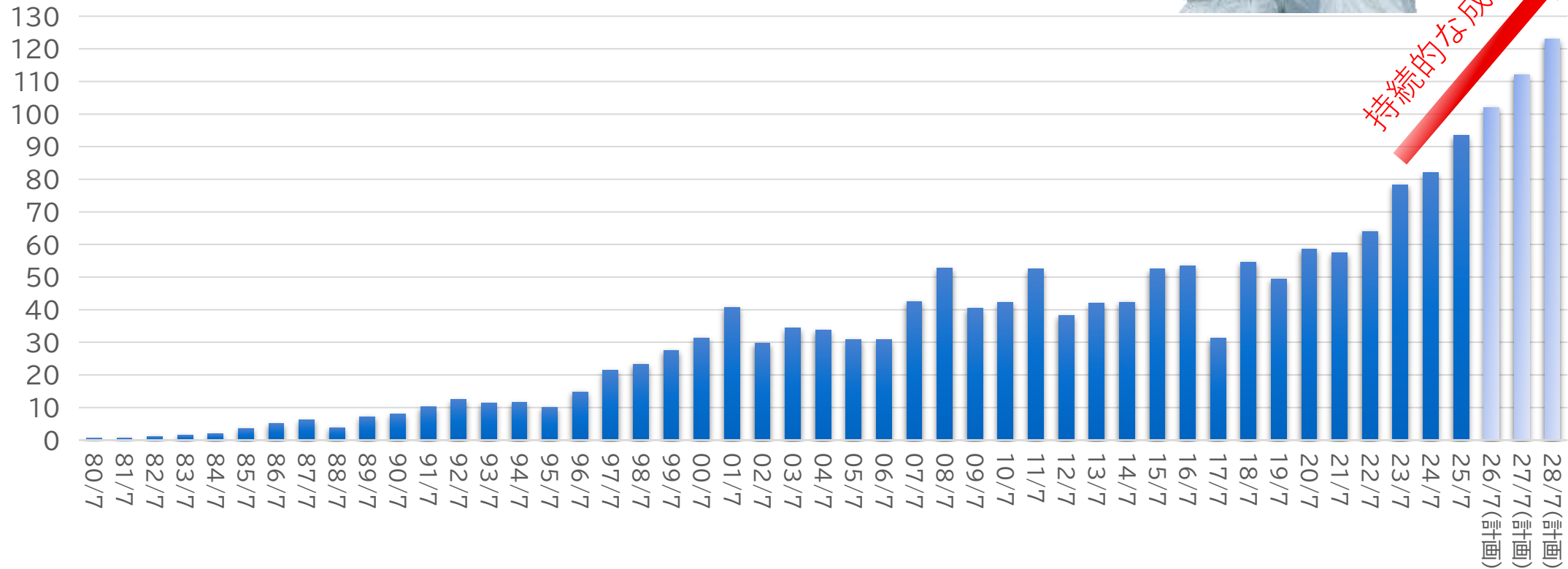


中期経営計画 ― そしてその先へ、

「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」の理念のもと
右肩上がりの成長を実現



売上高
(億円)



持続的な成長

04

質疑応答